

特別管理産業廃棄物排出源別一覧表（ばいじん、燃え殻）

廃棄物	物質名及び基準値										
	物質名		アルキル ⁴⁾ Hg	総 ⁴⁾ Hg	Cd	Pb	Cr (Ⅵ)	As	Se	DXN	
	基準値 ¹⁾	ばいじん、燃え殻 ²⁾	N.D. ³⁾	0.005	0.3	0.3	1.5	0.3	0.3	3	
		処理物 ³⁾	廃酸、廃アルカリの場合	N.D.	0.05	1	1	5	1	1	0.1
			廃酸、廃アルカリ以外の場合	N.D.	0.005	0.3	0.3	1.5	0.3	0.3	3
排出源			適用								
施設	規模										
ばいじん	3. 金属精錬又は無機化学工業品製造用焙焼炉、焼結炉及び燃焼炉	原料処理能力 1 t/h 以上	○	○	○		○	○	○		
	4. 金属の精錬の用に供する溶融炉、転炉及び平炉	原料処理能力 1 t/h 以上							○		
	5. 金属精錬又は鋳造用の溶解炉	火格子面積：1㎡以上 羽口面断面積：0.5㎡以上 バーナ燃焼能力；重油50ℓ/h以上 変圧器定格容量；200KVA以上のいずれかのもの	○	○	○	○			○		
	9. 廃棄物製品製造用焼成炉及び溶融炉	火格子面積：1㎡以上 バーナ燃焼能力；重油50ℓ/h以上			○	○		○	○		
	10. 無機化学工業品又は食料品製造用反応炉及び直火炉	変圧器定格容量；200KVA以上のいずれかのもの	○	○	○	○	○	○	○		
	11. 乾燥炉（Cu、Pb、Zn 精製用、トリポリリン酸ナトリウム製造用は除く）		○	○	○	○	○	○	○		
	12. 製鉄、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造用電気炉	変圧器定格容量；1,000KVA以上			○	○	○		○		
	14. 銅、鉛又は亜鉛の精錬用の焙焼炉、焼結炉、溶融炉、転炉、溶解炉及び乾燥炉	原料処理能力；0.5 t/h 以上、 火格子面積；0.5㎡以上、 羽口面断面積；0.2㎡以上、 バーナ燃焼能力；重油20ℓ/h以上のいずれかのもの			○	○		○	○		
	15. カドミウム系顔料又は炭酸カドミウム製造用の乾燥施設	容量0.1㎡以上			○				○		
	21. 燐、燐酸、燐酸肥料又は複合肥料の製造用反応施設、濃縮施設、焼成炉及び溶解炉	燐鉱石処理能力；80kg/h 以上、 バーナ燃焼能力；重油50ℓ/h 以上、 変圧器定格容量；200KVA 以上のいずれかのもの			○						
	23. トリポリリン酸ナトリウムを製造する反応施設、乾燥炉及び焼成炉	原料処理能力；80kg/h 以上、 火格子面積；1㎡以上 バーナ燃焼能力；重油50ℓ/h 以上のいずれかのもの			○						
	24. 鉛の第二次精錬又は鉛の管、板若しくは線の製造用溶解炉	バーナ燃焼能力；重油10ℓ/h 以上、 変圧器定格容量；40KVA 以上のいずれかのもの				○		○			
	25. 鉛蓄電池製造用の溶解炉	バーナ燃焼能力；重油 4 ℓ/h 以上、 変圧器定格容量；20KVA 以上のいずれかのもの				○					
	26. 鉛系顔料製造用溶解炉、反射炉、反応炉及び乾燥施設	容量；0.1㎡以上 バーナ燃焼能力；重油 4 ℓ/h 以上 変圧器定格容量；20KVA 以上のいずれかのもの				○					
	※ 2 製鋼（鋳鋼を除く）電気炉	変圧器の定格容量；1,000VA 以上								○	
	※ 4 アルミニウム合金製造焙焼炉、溶解炉、乾燥炉	焙焼炉及び乾燥炉；原料処理能力0.5 t/h 以上 溶解炉；容量 1 t 以上								○	
ばいじん 燃え殻	廃プラスチック類焼却施設	処理能力0.1 t/日を超え又は火格子面積 2 ㎡以上の施設			○	○	○		○		
	産業廃棄物焼却施設	処理能力200kg/h 以上又は火格子面積 2 ㎡以上の施設					○	○			
	産業廃棄物焼却炉である特定施設	処理能力50kg/h 以上又は火格子面積 0.5㎡以上の施設								○	

1) 基準値 mg/ℓ（溶出量）。ただし DXN の「汚泥」、「処理物の廃酸・廃アルカリ以外」は ng-TEQ/g（含有量）、「廃酸・廃アルカリ」、「処理物の廃酸・廃アルカリ」は ng-TEQ/ℓ（含有量）

2) 国内で生じたものであって、表中の排出源の施設から生じたもの

3) 1) を処分するために処理したもの

4) アルキル水銀化合物（アルキル Hg）、水銀又はその化合物（総水銀）は、燃え殻の場合対象とならない。

5) 環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。

(注) 施設番号は大気汚染防止法施行令別表第 1 による。

※印の施設番号はダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第 1 による。

特別管理産業廃棄物排出源別一覧表（廃油）

物質名		トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	1,3-ジクロロプロパン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン
基準値 〔mg/ℓ（溶出量）〕	廃溶剤 ¹⁾	※ ²⁾	※ ²⁾	※ ²⁾	※ ²⁾	※ ²⁾	※ ²⁾	※ ²⁾	※ ²⁾	※ ²⁾	※ ²⁾	—	—	—	※ ²⁾	—
	処理物 ³⁾	廃溶剤の場合	※ ²⁾	※ ²⁾	※ ²⁾	※ ²⁾	※ ²⁾	※ ²⁾	※ ²⁾	※ ²⁾	※ ²⁾	—	—	—	※ ²⁾	—
		廃酸、廃アルカリの場合	3	1	2	0.2	0.4	2	4	30	0.6	0.2	—	—	1	—
		廃油、廃酸、廃アルカリ以外の場合	0.3	0.1	0.2	0.02	0.04	0.2	0.4	3	0.06	0.02	—	—	0.1	—
排出源		適用														
業種	施設															
19. 紡績業又は繊維製品製造業若しくは加工業	ト 染色施設 チ 薬液浸透施設	○ ○	○ ○					○ ○	○ ○	○ ○						
21. 化学繊維製造業	ハ 原料回収施設			○			○								○	
23. パルプ、紙又は紙加工品製造業	リ セロハン製膜施設														○	
23の2. 新聞業、出版業、印刷業又は製版業	現像洗浄施設等	○	○	○			○	○	○							
28. カーバイト法アセチレン誘導品製造業	ホ 塩化ビニルモノマー洗浄施設					○										
33. 合成樹脂製造業	ニ 静置分離器			○	○	○	○			○					○	
41. 香料製造業	ロ 抽出施設	○	○	○	○		○	○							○	
47. 医薬品製造業	ニ 混合施設	○	○	○	○	○	○	○	○						○	
49. 農薬製造業	混合施設										○					
50. 第2条各号に掲げる物質を含有する試薬製造業	試薬製造施設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	
51. 石油精製業	ホ 潤滑油洗浄施設	○					○	○	○							
53. ガラス又はガラス製品製造業	イ 研磨洗浄施設			○					○							
66. 電気めっき施設		○	○	○	○	○	○	○	○							
67. 洗塩業	洗浄施設	○	○		○	○	○	○	○							
71の2. 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で環境省令で定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設	イ 洗浄施設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	
71の5. トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設		○	○	○												
写真感光材料製造業	溶解施設			○												
	表面処理施設	◎	◎	○	○	○	●	◎	○						○	

- 1) 国内で生じたものであって、表中の排出源の施設から生じたもの
 2) 1) を処分するために処理したもの
 3) 濃度に関係なく特別管理産業廃棄物となる。
 ●トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又は1,1,1-トリクロロエタンによる表面処理
 ○トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンによる表面処理
 (注) 業種番号と施設記号は水質汚濁防止法施行令別表第1による。
 基準値は、総理府令第5号、廃棄物処理法施行規則別表1（廃酸、廃アルカリ）による。

特別管理産業廃棄物排出源別一覧表（汚泥、廃酸、廃アルカリ）

物質名		アルキルHg	総Hg	Cd	Pb	有機P	Cr(VI)	As	CN	PCB	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,1-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	1,1,2,2-テトラクロロエタン	1,1,1,2-テトラクロロプロパン	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	DXN		
基準値 ¹⁾		汚泥の場合 ²⁾	ND	0.05	0.3	0.3	1	1.5	0.3	1	0.03	0.3	0.1	0.2	0.03	0.04	0.2	0.4	3	0.06	0.02	0.06	0.03	0.2	0.1	0.3	3	
		廃酸、廃アルカリの場合 ²⁾	ND	0.05	1	1	1	5	1	1	0.03	3	1	2	0.2	0.4	2	4	30	0.6	0.2	0.6	0.3	2	1	1	0.1	
		処理物 ³⁾	廃酸、廃アルカリの場合	ND	0.05	1	1	1	5	1	1	0.03	3	1	2	0.2	0.4	2	4	30	0.6	0.2	0.6	0.3	2	1	1	0.1
廃酸、廃アルカリ以外の場合	ND		0.05	0.3	0.3	1	1.5	0.3	1	0.03	0.3	0.1	0.2	0.03	0.04	0.2	0.4	3	0.06	0.02	0.06	0.03	0.2	0.1	0.3	3		
排出源		適用																										
業種	施設																											
19. 紡績業又は繊維製品製造業若しくは加工業	ト 染色施設 チ 薬液浸透施設 リ のり抜き施設						○				○	○				○	○	○										
21. 化学繊維製造業	イ 湿式紡糸施設 ロ リンター又は未精練繊維の薬液処理施設 ハ 原料回収施設											○	○													○		
22. 木材製品処理業	ロ 薬液浸透施設						○	○									○											
23. パルプ、紙、紙加工品の製造業	イ 原料浸せき施設 ニ 蒸解施設 ホ 蒸解廃液濃縮施設 ヘ チップ及びパルプ洗浄施設 ト 漂白施設 チ 抄紙施設 リ セロハン製膜施設 ヌ 湿式繊維板成型施設 ル 廃ガス洗浄施設									○	○	○	○	○												○	○	
23の2. 新聞業、出版業、印刷業又は製版業	現像洗浄施設等										○	○	○			○	○	○										
24. 化学肥料製造業	イ ろ過施設 ロ 分離施設 ハ 水洗式破砕施設 ニ 廃ガス洗浄施設 ホ 湿式集じん施設							○																				
25. 水銀電解法によるか性ソーダ又はか性カリ製造業	イ 塩水精製施設 ロ 電解施設	○	○																									
26. 無機顔料製造業	イ 洗浄施設 ロ ろ過施設 ハ カドミウム系無機顔料製造施設のうち遠心分離機 ホ 廃ガス洗浄施設	○	○	○	○		○		○																	○	○	
27. 前2号以外の無機化学工業製品製造業	イ ろ過施設 ロ 遠心分離機 ヘ 青酸反応施設のうち反応施設 ヌ 廃ガス洗浄施設 ル 湿式集じん施設	○	○	○	○		○	○	○	○																○	○	
28. カーバ이트法アセチレン誘導品製造業	イ 湿式アセチレンガス発生施設 ホ 塩化ビニルモノマー洗浄施設								○							○												
29. コールタール製品製造業	イ ベンゼン類硫酸洗浄施設 ロ 静置分離器																								○	○		

物質名		アルキルHg	総Hg	Cd	Pb	有機P	Cr(VI)	As	CN	PCB	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,1-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	1,3-ジクロロプロパン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	D X N
基準値 ²⁾	汚泥の場合 ²⁾	ND	0.05	0.3	0.3	1	1.5	0.3	1	0.00	0.3	0.1	0.2	0.02	0.04	0.2	0.4	3	0.06	0.02	0.06	0.03	0.2	0.1	0.3	3
	廃酸、廃アルカリの場合 ²⁾	ND	0.05	1	1	1	5	1	1	0.00	3	1	2	0.2	0.4	2	4	30	0.6	0.2	0.6	0.3	2	1	1	0.1
	処理物 ¹⁾ 廃酸、廃アルカリの場合	ND	0.05	1	1	1	5	1	1	0.00	3	1	2	0.2	0.4	2	4	30	0.6	0.2	0.6	0.3	2	1	1	0.1
	処理物 ¹⁾ 廃酸、廃アルカリ以外の場合	ND	0.05	0.3	0.3	1	1.5	0.3	1	0.00	0.3	0.1	0.2	0.02	0.04	0.2	0.4	3	0.06	0.02	0.06	0.03	0.2	0.1	0.3	3
排出源		適用																								
業種	施設																									
31. メタン誘導品製造業	イ メチルアルコール又は四塩化炭素の製造施設のうち蒸留施設 ハ フロンガス製造施設のうち、洗浄施設及びろ過施設											○	○													
32. 有機顔料又は合成染料製造業	イ ろ過施設 ロ 顔料又は染色レーキの製造施設のうち、水洗施設 ハ 遠心分離機 ニ 廃ガス洗浄施設					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	
33. 合成樹脂製造業	ロ 水洗施設 ハ 遠心分離機 ニ 静置分離器 ホ フッ素樹脂製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設及び蒸留施設 リ 廃ガス洗浄施設 ヌ 湿式集じん施設					○	○		○			○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	
34. 合成ゴム製造業	イ ろ過施設 ロ 脱水施設 ハ 水洗施設 ニ ラテックス濃縮施設 ホ スチレン・ブタジエンゴム、ニトリル・ブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムの製造施設のうち、静置分離器						○	○			○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○	
35. 有機ゴム製品製造業	イ 蒸留施設 ロ 分離施設 ハ 廃ガス洗浄施設																			○	○	○				
37. 前6号以外の石油化学工業	イ 洗浄施設 ロ 分離施設 ハ ろ過施設 ニ アクリロニトリルの製造施設のうち、急冷施設及び蒸留施設 ホ アセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、テレフタル酸又はトリレンジアミン製造施設のうち、蒸留施設 ヘ アルキルベンゼン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設 ト イソプロピルアルコール製造施設のうち、蒸留施設及びろ							○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	

物質名		アルキルHg	総Hg	Cd	Pb	有機P	Cr(VI)	As	CN	PCB	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,1-ジクロロエタン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-ジクロロエタン	シス1,2-ジクロロエタン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-ジクロロプロパン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	DXN	
基準値 ¹⁾	汚泥の場合 ²⁾	ND	0.05	0.3	0.3	1	1.5	0.3	1	0.03	0.3	0.1	0.2	0.04	0.2	0.4	3	0.6	0.02	0.6	0.02	0.2	0.1	0.3	3		
	廃酸、廃アルカリの場合 ²⁾	ND	0.05	1	1	1	5	1	1	0.03	3	1	2	0.2	0.4	2	4	30	0.6	0.2	0.6	0.3	2	1	1	0.1	
	処理物 ³⁾	廃酸、廃アルカリの場合	ND	0.05	1	1	1	5	1	1	0.03	3	1	2	0.2	0.4	2	4	30	0.6	0.2	0.6	0.3	2	1	1	0.1
		廃酸、廃アルカリ以外の場合	ND	0.05	0.3	0.3	1	1.5	0.3	1	0.03	0.3	0.1	0.2	0.04	0.2	0.4	3	0.6	0.02	0.6	0.02	0.2	0.1	0.3	3	
排出源		適用																									
業種	施設																										
37. 前6号以外の石油化学工業	メ 酸濃縮施設 シクロヘキサノン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設 ブ ノルマルパラフィン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設及びメチルアルコール蒸留施設 ヨ メチルメタクリレートモノマー製造施設のうち、反応施設及びメチルアルコール回収施設 タ 廃ガス洗浄施設																										
41. 香料製造業	イ 洗浄施設 ロ 抽出施設																										
43. 写真感光材料製造業	感光剤洗浄施設																										
46. 第28号から前号までに掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業	イ 水洗施設 ロ ろ過施設 ニ 廃ガス洗浄施設																										
47. 医薬品製造業	ロ ろ過施設 ハ 分離施設 ニ 混合施設 ホ 廃ガス洗浄施設																										
49. 農薬製造業	混合施設																										
50. 第2条各号に掲げる物質を含有する試薬製造業	試薬製造施設																										
51. 石油精製業	イ 脱塩施設 ロ 原油常圧蒸留施設 ハ 脱硫施設 ニ 揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設 ホ 潤滑油洗浄施設																										
51の2. 自動車用タイヤ若しくは自動車用チューブ製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品製造業、更生タイヤ製造業又はゴム板製造業	直接加硫施設																										
53. ガラス又はガラス製品製造業	イ 研磨洗浄施設 ロ 廃ガス洗浄施設																										
58. 農薬原料精製業	イ 水洗式破砕施設 ロ 水洗式分別施設 ハ 酸処理施設 ニ 脱水施設																										

物質名		アルキルHg	総Hg	Cd	Pb	有機P	Cr(VI)	As	CN	PCB	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,1-ジクロロエタン	1,1,1-トリクロロエタン	シス1,2-ジクロロエチレン	1,1-ジクロロエタン	1,2-ジクロロエタン	1,1,1-トリクロロプロパン	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	DXN		
基準値 ²⁾	汚泥の場合 ²⁾	ND	0.05	0.3	0.3	1	1.5	0.3	1	0.00	0.3	0.1	0.2	0.02	0.04	0.2	0.4	3	0.06	0.02	0.06	0.03	0.2	0.1	0.3	3	
	廃酸、廃アルカリの場合 ²⁾	ND	0.05	1	1	1	5	1	1	0.00	3	1	2	0.2	0.4	2	4	30	0.6	0.2	0.6	0.3	2	1	1	0.1	
	処理物 ³⁾	廃酸、廃アルカリの場合	ND	0.05	1	1	1	5	1	1	0.00	3	1	2	0.2	0.4	2	4	30	0.6	0.2	0.6	0.3	2	1	1	0.1
		廃酸、廃アルカリ以外の場合	ND	0.05	0.3	0.3	1	1.5	0.3	1	0.00	0.3	0.1	0.2	0.02	0.04	0.2	0.4	3	0.06	0.02	0.06	0.03	0.2	0.1	0.3	3
排出源		適用																									
業種	施設																										
61. 鉄鋼業	イ タール及びガス液分離施設 ロ ガス冷却洗浄施設								○															○			
62. 非鉄金属製造業	イ 還元ろ ロ 電解施設 ニ 水銀精製施設 ホ 廃ガス洗浄施設 ヘ 湿式集じん施設								○																○		
		○	○		○				○																○		
		○	○	○	○				○																○		
63. 金属製品製造業又は機械器具製造業	イ 焼入れ施設 ロ 電解式洗浄施設 ハ カドミウム電極又は鉛電極の化成施設 ニ 水銀精製施設 ホ 廃ガス洗浄施設								○																	○	
		○	○		○				○																	○	
64. ガス供給業又はコークス製造業	イ タール及びガス液分離施設 ロ ガス冷却洗浄施設								○															○			
									○															○			
65. 酸又はアルカリによる表面処理施設				○	○		○	○																	○		
66. 電気めっき施設				○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
66の2. 旅館業	ハ 入浴施設							○																			
67. 洗濯業	洗浄施設										○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
68. 写真現像業	現像洗浄施設			○					○																		
71の2. 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で環境省令で定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設	イ 洗浄施設 ロ 焼入れ施設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
71の5. トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設											○	○	○														
71の6. トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施設													○														
写真感光材料製造業	溶解施設												○														
石油精製業	改質施設																○	○									
トリニトロフェノール鉛製造施設					○																						
青化法精製施設									○																		
石油製品製造業	蒸留施設										○	○		○	○	○	○	○	○	○				○			
廃油	イ 蒸留施設 ロ 表面処理施設										○	○		○	○	○	○	○	○	○				○			
アセチレン精製施設		○	○																								
その物質による表面処理施設											○	○	○	○	○		○										
トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンによる表面処理施設																○											

物質名		アルキルHg	総Hg	Cd	Pb	有機P	Cr(VI)	As	CN	PCB	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	1,3-ジクロロプロパン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	DXN		
基準値 ¹⁾	汚泥の場合 ²⁾	ND	0.05	0.3	0.3	1	1.5	0.3	1	0.03	0.3	0.1	0.2	0.03	0.04	0.2	0.4	3	0.6	0.02	0.05	0.02	0.2	0.1	0.3	3		
	廃酸、廃アルカリの場合 ²⁾	ND	0.05	1	1	1	5	1	1	0.03	3	1	2	0.2	0.4	2	4	30	0.6	0.2	0.6	0.3	2	1	1	0.1		
	処理物 ³⁾	廃酸、廃アルカリの場合	ND	0.05	1	1	1	5	1	1	0.03	3	1	2	0.2	0.4	2	4	30	0.6	0.2	0.6	0.3	2	1	1	0.1	
		廃酸、廃アルカリ以外の場合	ND	0.05	0.3	0.3	1	1.5	0.3	1	0.03	0.3	0.1	0.2	0.03	0.04	0.2	0.4	3	0.6	0.02	0.05	0.02	0.2	0.1	0.3	3	
排出源		適用																										
業種	施設																											
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又は1,1,1-トリクロロエタンによる表面処理施設																	○											
指定下水汚泥		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																
※1 硫酸パルプ又は亜硫酸パルプ製造の廃棄物又は廃棄物処理施設																											○	
※2 カーバイド法アセチレン製造のアセチレン洗浄施設																											○	
※3 硫酸カリウム製造施設のうち、廃ガス洗浄施設																											○	
※4 アルミナ繊維製造施設のうち、廃ガス洗浄施設																											○	
※5 塩化ビニルモノマー製造施設のうち、二塩化エチレン洗浄施設																											○	
※6 カプロラクタム製造施設のうち、硫酸濃縮施設、シクロヘキサノ分留施設、廃ガス洗浄施設																											○	
※7 クロロベンゼン又はジクロロベンゼン製造施設のうち、水洗浄施設、廃ガス洗浄施設																											○	
※8 4-クロロフタル酸水素ナトリウム製造施設のうち、ろ過施設、乾燥施設、廃ガス洗浄施設																											○	
※9 2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノン製造施設のうち、ろ過施設、廃ガス洗浄施設																											○	
※10 ジオキサジンバイオレット製造施設のうち、ニトロ化誘導体分留施設及び還元誘導体分留施設、ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設																											○	
※11 アルミニウム又はその合金製造熔炉等の発生ガス処理施設のうち、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設																											○	
※12 亜鉛回収施設のうち、精製施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設																											○	
※13 廃棄物焼却炉（火床面積が0.5㎡以上又は焼却能力が50kg/h以上のもの）の発生ガス処理施設のうち、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの																											○	
※14 廃 PCB 等又は PCB 処理物分解施設、PCB 汚染物又は PCB 処理物洗浄施設又は分留施設																											○	
※15 担体付き触媒の製造（遊走又は遊走水素化合物を使用するものに限る。）の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設																											○	

物質名		アルキルHg	総Hg	Cd	Pb	有機P	Cr(VI)	As	CN	PCB	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,1-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	1,1,3-ジクロロプロパン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	DXN	
基準値 ²⁾	汚泥の場合 ²⁾		ND ⁴⁾	0.05	0.3	0.3	1	1.5	0.3	1	0.03	0.3	0.1	0.2	0.02	0.04	0.2	0.4	3	0.06	0.02	0.06	0.03	0.2	0.1	0.3	3
	廃酸、廃アルカリの場合 ²⁾		ND	0.05	1	1	1	5	1	1	0.03	3	1	2	0.2	0.4	2	4	30	0.6	0.2	0.6	0.3	2	1	1	0.1
	処理物 ³⁾	廃酸、廃アルカリの場合	ND	0.05	1	1	1	5	1	1	0.03	3	1	2	0.2	0.4	2	4	30	0.6	0.2	0.6	0.3	2	1	1	0.1
		廃酸、廃アルカリ以外の場合	ND	0.05	0.3	0.3	1	1.5	0.3	1	0.03	0.3	0.1	0.2	0.02	0.04	0.2	0.4	3	0.06	0.02	0.06	0.03	0.2	0.1	0.3	3
排出源			適用																								
業種	施設																										
※16 担体付き触媒（使用済みのものに限る。）から金属の回収（ソーダ灰を添加してばい焼炉で処理する方法及びアルカリによる抽出する方法（ばい焼炉で処理しないものに限る。）によるものを除く。）の用に供する施設のうち、次に掲げるもの ・ろ過施設 ・精製施設 ・廃ガス洗浄施設																											○
※17 フロン類（特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令別表1の項、3の項及び6の項に掲げる特定物質をいう。）の破壊（プラズマを用いて破壊する方法その他環境省令で定める方法に限る。＊1）の用に供する施設のうち、次に掲げるもの ・プラズマ反応施設 ・廃ガス洗浄施設 ・湿式集じん施設 （＊1 廃棄物湿焼法、液中燃焼法、過熱蒸気反応法）																											○

- 1) 基準値ng/ℓ（溶出量）。ただし DXN の「汚泥」、「処理物の廃酸・廃アルカリ以外」は ng-TEQ/g（含有量）、「廃酸・廃アルカリ」、「処理物の廃酸・廃アルカリ」は ng-TEQ/ℓ（含有量）
- 2) 国内で生じたものであって、表中の排出源の施設から生じたもの
- 3) 1) を処分するために処理したもの
- 4) 環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。
- (注) 業種番号と施設記号は水質汚濁防止法施行令別表第1による。
- ※印の業種番号と施設記号はダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2による。
- 基準値は総理府令第5号（ダイオキシン類は環境省令）、廃棄物処理法施行規則別表1（廃酸、廃アルカリ）による。